

공고특허97-007711

(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 특허공보(B1)(51) Int. Cl. 6  
H04N 5/30  
H01L 27/148(45) 공고일자 1997년05월15일  
(11) 공고번호 97-007711  
(24) 등록일자

(21) 출원번호	특1993-0008468	(65) 공개번호	특1994-0027509
(22) 출원일자	1993년05월18일	(43) 공개일자	1994년12월10일
(73) 특허권자	경기도 수원시 팔달구 매탄동 416번지		
(72) 발명자	김범식		
(74) 대리인	이영필 박영우 이윤민		

심사관 : 이현수 (책자공보 제5009호)

(64) 오버-플로우 드레인(OFD)구조를 가지는 전하결합소자형 고체활상장치

## 요약

내용없음.

## 대표도

도1

## 영세서

[발명의 명칭]오버-플로우 드레인(OFD)구조를 가지는 전하결합소자형 고체활상장치[도면의 간단한 설명]제1도는 일반적인 전하결합소자형 고체활상장치의 확소 레이아웃도.

제2도는 상기 제1도의 A-A'를 자른 종래의 오버-플로우 드레인구조를 나타내는 단면도.

제3도는 상기 제2도의 B-B'선의 전위분포도.

제4도는 본 발명의 오버-플로우 드레인의 동작에 따른 신호전하와 입사조도와의 관계를 나타낸다이아그램.

제5도는 본 발명의 오버-플로우 드레인구조에서 전자셔터동작을 설정하기 위한 타이밍 차트.

제6도는 본 발명의 일상시예에 의한 오버-플로우 드레인구조를 나타내는 단면도.

제7도는 상기 제4도의 C-C'선의 전위분포도.

제8도는 본 발명의 다른 실시예에 의한 오버-플로우 드레인구조를 나타내는 단면도.

제9도는 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 오버-플로우 드레인구조를 나타내는 단면도.

[발명의 상세한 설명]본 발명은 전하결합소자(Charge Coupled Device; 이하 CCD)형 고체활상장치 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 특히 반도체기판의 표면측에 오버-플로우 드레인구조를 형성하여 온 칩(on chip) 회로를 실현할 수 있도록 구성된 CCD형 고체활상장치 및 그 제조방법에 관한 것이다.